



即时发表

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)

Open Sky Communications

电话: +1-415-519-3915

电邮: dmoreno@openskypr.com

ASML 加盟 THE EBEAM INITIATIVE

eBeam Initiative 在半导体光罩和光刻供应链公司中，达到 50 家成员的新里程碑

圣荷西，加州，美国，二零一九年二月二十六日—The eBeam Initiative，一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体，今天宣布，ASML 正式加入 eBeam Initiative。作为世界领先的半导体芯片仪器制造商，ASML 将为 eBeam Initiative 在半导体光罩和光刻供给链教育活动带来宝贵的观点。

2009 年，the eBeam Initiative 正式成立，旨在半导体设计和制造业界为电子束技术教育平台呼吁助力。The eBeam Initiative 利用年度会员意见调查和光罩制造商调查确定重要趋势来帮助引导业界前行，以支持新电子束技术的引进。能达到 50 家成员的里程碑，the eBeam Initiative 持续它的创立宗旨来加强业界的联盟，促进电子束技术整体生态发展。

今天，在圣荷西举办的 SPIE 先进光刻技术会议 (Advanced Lithography Conference) 期间，the eBeam Initiative 的年度午餐会同期举行，ASML 资深副总裁曹宇 (Dr. Yu Cao) 博士；HJL Lithography 的哈利·莱文森博士 (Dr. Harry Levinson)；D2S 首席产品官及行政副总裁庞琳勇博士 (Dr. Leo Pang) 将在午餐会上做主题讲演。三位业界名人会涉猎有关电子束相关，且关乎光罩制造和光刻未来成功的题目，包括：EUV 微影模拟；应用深度学习及 GPU 加速光罩模拟；以及机器学习在计算微影上的应用。讲演稿将在二月二十六后上传到 the eBeam Initiative website: www.ebeam.org.

“ASML 的加入将会为 eBeam Initiative 提供非常有价值的视角，” D2S 执行长藤村 (Aki Fujimura) 先生表示，D2S 是 eBeam Initiative 的主办管理公司。“ASML 在光刻制程模型和模拟以及电子束测量和检验（通过并购 HMI）拥有独特的技术。ASML 的加入扩展了对光罩刻写的测量和检验，及计算微影的了解。为了电子束技术创新的持续发展，对像 the eBeam Initiative

类似的整个业界合作努力的需求，就变得非常重要。我们非常高兴能欢迎 ASML 成为我们使命的最新贡献者，为了加速电子束技术在全新半导体制造领域的合作提供帮助。”

关于 The eBeam Initiative (电子束倡议团)

The eBeam Initiative 是一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体；为有关电子束技术的教育和促进活动提供相应的论坛。The eBeam Initiative 的目标是增加电子束技术应用在半导体制造各领域中的投资；降低电子束技术应用的障碍，能够使更多集成电路设计完成，并且更快投进市场成为可能。

会员公司，涵盖整个半导体生态系统，包括: aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; ASML; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; eSilicon Corporation; Fraunhofer CNT; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GLOBALFOUNDRIES; Grenon Consulting; Hitachi High-Technologies; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KLA; Maglen; Mentor, a Siemens Business; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photronics; Sage Design Automation; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); STMicroelectronics; Synopsys; tau-Metrix; Tela Innovations; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Toppan Printing; Toshiba; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS. The eBeam Initiative 欢迎所有电子工业的公司和协会加盟。细节请查看 www.ebeam.org.

###